



J20

ION SPUTTER COATER

双靶离子溅射仪

The J20 is a dual-target ion sputter coater based on the principle of magnetron sputtering. It uses a high-performance rotary vane pump to quickly achieve a vacuum pressure of less than 3 Pa. Equipped with a proprietary rotary-tilting sample stage, it deposits a more homogeneous and stable conductive layer on the sample surface. It is widely suitable for applications such as sputtering gold, platinum, and platinum-gold layered alloy on field emission electron microscope (FE-SEM) samples that require higher resolution, particularly for 3D powder and delicate samples.

J20是一款双靶离子溅射仪，基于磁控溅射原理，采用高性能旋片泵快速产生一个低于3Pa的真空压强，搭配自主研发的旋转偏转样品台，在样品表面沉积一层更均匀稳定的导电膜层，广泛适用于追求更高分辨率场发射电镜样品、特别是3D粉末类和易损伤类样品的喷金、喷铂、喷镀铂金叠层合金等用途。

触摸屏控制，即插即用。



双靶磁控溅射

特色Pt-Au叠层配方

离子溅射仪中的SUV

样品场景通用性强

模块化旋转偏转样品台

喷镀无死角

SuPro Instruments LTD

速普仪器

Nanshan ,

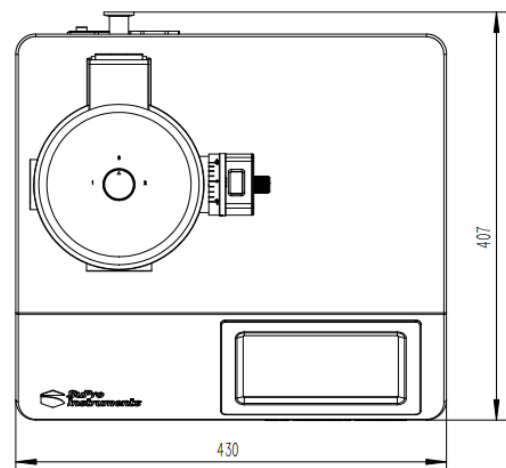
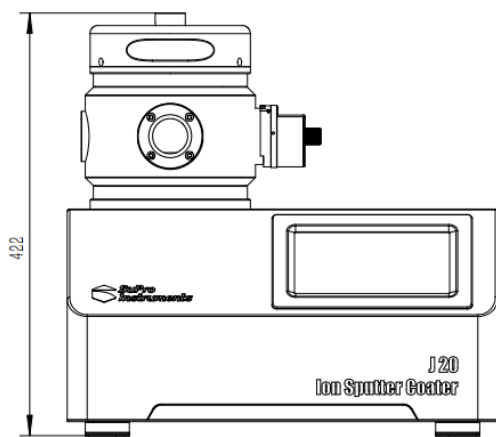
Shenzhen, China

www.suproinst.com

Tel: 86-755-26642901

Fax: 86-755-26419205

技术规格	参数
真空泵	高性能旋片泵
抽速	$\geq 4 \text{ m}^3/\text{h}$
极限真空	$< 1\text{Pa}$
工作气压	4-10 Pa, 可恒压控制
抽真空时间	$< 3-5 \text{ Min}$
真空规	皮拉尼真空计
腔室尺寸	$\sim \text{Ø} 135 * 120 \text{ mm}$ (内尺寸)
数显样品台	$\text{Ø}75\text{mm}$ 旋转偏转样品台, 旋转转速: 10-60RPM连续可调, 偏转角度: $\pm 40^\circ$ 连续可调, 靶基距40-60mm连续可调
溅射靶材	靶材尺寸 $\text{Ø} 30 * 0.2-0.5 \text{ mm}/2$ 只, 可实现单靶溅射、双靶共溅射、双靶交替溅射功能
溅射电源	恒功率DC溅射电源 Max. 20W , Max. 100 mA, 0-800 V DC
操作方式	触摸屏控制, 控制系统提供互锁保护功能
重量	主机 $\sim 21.5 \text{ kg}$
尺寸	$\sim 430\text{mm}$ 长 * 407mm 深 * 422mm 高
电源	100-220V AC, 50/60Hz 接地三脚插头
功耗	$< 500 \text{ W}$
质保	一年
备注	以上所列技术规格与参数更新恕不另行通知, 如有疑问请联系我们



深圳市速普仪器有限公司
 地址: 深圳市南山区桂庙路22号向南瑞峰B2009
 电话: 0755-26642901 传真: 0755-26419205
 邮件: sales@suproinst.com
 www.suproinst.com

速普仪器(太仓)有限公司
 地址: 苏州市太仓健雄路大学科技园11号楼1003
 邮件: zkchang@suproinst.com
深圳市速普仪器有限公司(北京办)
 地址: 北京市房山区怡和北路5号院熙悦汇4号楼307室